

Bibliography

- [1] The Royal Society. *Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties*. The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, London, UK, 2004.
- [2] G. Schmid. *Nanoparticles*. Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2004.
- [3] A. P. Alivisatos. *Science*, 271:933, 1996.
- [4] C. Delerue and M. Lanno. *Nanostructures: Theory and Modeling*. Springer, Berlin, 2004.
- [5] K. E. Andersen, C. Y. Fong, and W. E. Pickett. *J. Non-Cryst. Solids*, 299:1105, 2002.
- [6] R. S. Knox. *Theory of Excitons*. Academic Press, New York, 1963.
- [7] Y. Wang and N. Herron. *J. Phys. Chem.*, 95(2):525, 1991.
- [8] L. E. Brus. *J. Chem. Phys.*, 79:5566, 1983.
- [9] Y. Wang and N. Herron. *Phys. Rev. B*, 42:7253, 1990.
- [10] M. Behet, K. V. D. Zanden, G. Borghs, and A. Behres. *Appl. Phys. Lett.*, 73:2760, 1998.

- [11] S. Nakamura, M. Senoh, S. Nagahama, N. Iwasa, T. Matsushita T. Yamada, H. Kiyoku, and Y. Sugimoto. *Jpn. Appl. Phys.*, 35:L74, 1996.
- [12] J. Westwater, D. P. Gosain, S. Tomiya, S. Usui, and H. Ruda. *J. Vac. Sci. Technol. B*, 15:554, 1997.
- [13] L. Guan, K. Suenaga, S. Okubo, T. Okazaki, and S. Iijima. *J. Am. Chem. Soc.*, 130:2162, 2008.
- [14] Q. Wan, H. Li, Y. J. Chen, T. H. Wang, X. L. He, P. Li, and C. L. Lin. *Appl. Phys. Lett.*, 84:3654, 2004.
- [15] M. Law, L. E. Greene, J. C. Johnson, R. Saykally, and P. Yang. *Nature Mater. Lett.*, 4:455, 2005.
- [16] M. A. Reed, J. N. Randall, R. J. Aggarwal, R. J. Matyi, T. M. Moore, and A. E. Wetsel. *Phys. Rev. Lett.*, 60:535, 1988.
- [17] K. Barnham and D. Vvedensky. *Low-Dimensional Semiconductors*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001.
- [18] T. J. Bukowski and J. H. Simmon. *Crit. Rev. solid state Mater. Sci.*, 27:119, 2002.
- [19] S. Barik, A. K. Srivastava, P. Misra, R. V. Nandedkar, and L. M. Kukreja. *Solid State Commun.*, 127:463, 2003.
- [20] L. E. Brus. *J. Chem. Phys.*, 80:4403, 1984.
- [21] E. O. Chukwuocha, M. C. Onyeaju, and T. S. T. Harry. *World J. Cond. Mater. Phys.*, 2:96, 2012.
- [22] Y. Kayanuma. *Phys. Rev. B*, 38:9797, 1988.

- [23] P. Harrison. *Theoretical and Computational Physics of Semiconductor nanostructures*. Wiley, Germany, 2009.
- [24] U. Merkt, J. Huser, and M. Wagner. *Phys. Rev. B*, 43:7320, 1991.
- [25] S. J. Lee, N. H. Shin, J. J. Ko, M. J. Park, and R. Kummel. *Semicond. Sci. Technol.*, 7:1072, 1992.
- [26] J. N. Kim, J. W. Shin, K. M. Oh, S. K. Park, R. N. Lee, and S. H. Nam. doi:10.1088/1748-0221/6/11/C11027, 2011.
- [27] P. Ghosh. *Introduction to Nanomaterials and Nanotechnology*. NPTEL, Guwahati, India, 2013.
- [28] C. Herring and J. K. Galt. *Phys. Rev.*, 85:1060, 1952.
- [29] G. Cao. *Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications*. Imperial College Press, London, 2004.
- [30] H. Ogawa, M. Nishikawa, and A. Abe. *J. Appl. Phys.*, 53:4448, 1982.
- [31] J. Knight. *New Sci.*, 162(2180):40, 1999.
- [32] J. Travis. *Science*, 267:1593, 1995.
- [33] L. L. Sohn, L. P. Kouenhoven, and G. Schoen. *Mesoscopic Electron Transport*. Kluwer, Dordrecht, 1996.
- [34] S. Frank, P. Poncharal, Z. L. Wang, and W. A. de Heer. *Science*, 280:1744, 1998.
- [35] S. Raghavan, H. Wang, R. B. Dinwiddie, W. D. Porter, and M.J. Mayo. *Scripta Mater.*, 39:1119, 1998.

- [36] L. H. Terrell. *Thermodynamics of Small Systems*. Dover, New York, 1994.
- [37] L. Dong, M. M. Craig, D. Khang, and C. Chen. *J. Nanotechnology*, 2012:816184 (1), 2012.
- [38] E. Yablonovitch. *Phys. Rev. Lett.*, 58:2059, 1987.
- [39] J. D. Joannopoulos, P. R. Villeneuve, and S. H. Fan. *Nature*, 386:143, 1997.
- [40] J. E. G. J. Wijnhoven and W. L. Vos. *Science*, 281:802, 1998.
- [41] Y. N. Xia and G. M. Whitesides. *Angewandte Chemie Int. Ed.*, 37:551, 1998.
- [42] K. N. Vlasov. *Am. Phys. Soc. Centennial Meeting*. Atlanta GA, 1999.
- [43] A. J. Nozik and R. Memming. *J. Phys. Chem.*, 100:13061, 1996.
- [44] E. Susie and A. E Mostafa. *Chem. Soc. Rev.*, 35:209, 2006.
- [45] J. Kuma, N. Kitajima, Y. Kanai, and H. Fukunaga. *J. Appl. Phys.*, 83:6623, 1998.
- [46] A. Inoue, A. Takeuchi, and T. Zhang. *Metall. Mater. Trans.*, 29A:1779, 1998.
- [47] E. E. Fullerton, J. S. Jiang, C. H. Sowers, J. E. Pearson, and S. D. Bader. *Appl. Phys. Lett.*, 72:380, 1998.
- [48] R. Notzel. *Microelectron. J*, 28:875, 1997.
- [49] S. Kasap and P. Capper. *Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer, USA, 2007.

- [50] C. Ma, D. Moore, Y. Ding, J. Li, and Z. L. Wang. *Int. J. Nanotechnology*, 1:4, 2004.
- [51] J. Gutowski, P. Michler, H. I. Ruckmann, H. G Brunig, M. Rowe, K. Seibald, and T. Voss. *Phys. Stat. Sol. B*, 234:70, 2002.
- [52] J. K. Furdyna. *J. Appl. Phys.*, 64:R29, 1988.
- [53] M. Snure, D. Kumar, and A. Tiwari. *Spintronic Materials and Devices*, 61:72, 2009.
- [54] Z. L. Wang. *Mater. Today*, 7:26, 2004.
- [55] G. H. Du, F. Xu, and G. V. Tendeloo. *Appl. Phys. Lett.*, 88:243101, 2006.
- [56] D. I. Rusu, G. G. Rusu, and D. Luca. *Acta Phys. Pol. A*, 119:6, 2011.
- [57] M. H. Huang, S. Mao, H. Feick, H. Q. Yan, Y. Y. Wu, H. Kind, E. Weber, R. Russo, and P. D. Yang. *Science*, 292:1897, 2001.
- [58] U. Ozgur, Y. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Dogan, V. Avrutin, S. J. Cho, and H. Morkoc. *J. Appl. Phys.*, 98:041301, 2005.
- [59] R. R. Reeber. *J. Appl. Phys.*, 41:5063, 1970.
- [60] C. H. Bates, W. B. White, and R. Roy. *Science*, 137:993, 1962.
- [61] A. Moezzi, A. M. McDonagh, and M. B. Cortie. *Chem. Eng. J.*, 185:1, 2012.
- [62] J. Zhang, L. Sun, J. Yin, H. Su, C. Liao, and C. Yan. *Chem. Mater.*, 14:4172, 2002.

- [63] M. Saito. *J. Ind. Text.*, 23:150, 1993.
- [64] S. Baruah and J. Dutta. *Sci. Technol. Adv. Mater*, 10:013001, 2009.
- [65] S. K. Mishra, R. K. Srivastava, and S. G. Prakash. *J. Alloys. Compd.*, 539:1, 2012.
- [66] R. G. Heideman, P. V. Lambeck, and J. G. E. Gardeniers. *Opt. Mater.*, 4:741, 1995.
- [67] A. B. Djuricic, X. Chen, Y. H. Leung, and A. M. C. Ng. *J. Mater. Chem.*, 22:6526, 2012.
- [68] M. Law, L. E. Greene, J. C. Johnson, R. Saykally, and P Yang. *Nat. Mater.*, 4:455, 2005.
- [69] X. Y. Kong and Z. L. Wang. *Nano Lett.*, 3:1625, 2003.
- [70] Q. Wan, Q. H. Li, Y. J. Chen, T. H. Wang, X. L. He, J. P. Li, and C. L. Lin. *Appl. Phys. Lett.*, 84:3654, 2004.
- [71] C. H. Liu, J. A. Zapien, Y. Yao, X. M. Meng, C. S. Lee, Y. Lifshitz, S. S. Fan, and S. T. Lee. *Adv. Mater.*, 15:838, 2003.
- [72] H. E. Unalan, P. Hiralal, N. Rupesinghe, W. I Milne S. Dalal, and G.A J Amaratunga. *Nanotechnology*, 19:255608, 2008.
- [73] G. C. Yi, C. Wang, and W. Il Park. *Semicond. Sci. Technol.*, 20:S22, 2005.
- [74] Y. Xi, J. Song, S. Xu, R. Yang, Z. Gao, C. Hu, and Z. L. Wang. *J. Mater. Chem.*, 19:9260, 2009.

- [75] G. Z. Xing, X. S. Fang, Z. Zhang, D. D. Wang, X. Huang, J. Guo, L. Liao, Z. Zheng, H. R. Xu, T. Yu, Z. X. Shen, C. H. A. Huan, T. C. Sum, H. Zhang, and T. Wu. *Nanotechnology*, 21:255701, 2010.
- [76] W. I Park, G. C. Yi, M. Kim, and S. J. Pennycook. *Adv. Mater.*, 14:1841, 2002.
- [77] W. L. Hughes and Z. L. Wang. *Appl. Phys. Lett.*, 86:043106, 2005.
- [78] P. Li, Y. Wei, H. Liua, and X. Wang. *Chem. Commun.*, 1:2856 (DOI: 10.1039/B409425E), 2004.
- [79] P. Gao, C. Ying, S. Wang, L. Ye, Q. Guo, and Y. Xie. *J. Nano. Res.*, 8:131, 2006.
- [80] D. Barreca, D. Bekermann, E. Comini, A. Devi, R. A. Fischer, A. Gasparotto, C. Maccato, C. Sada, G. Sberveglieri, and E. Tondello. *Cryst. Eng. Comm.*, 12:3419, 2010.
- [81] G. H. Yong, Y. F. Wang, Z. Yang, L. J. Min, and Z. Y. Ping. *Chin. Phys. Lett.*, 25:640, 2008.
- [82] M. S. Kumar, D. Chhikara, and K. M. K. Srivatsa. *Cryst. Res. Technol.*, 46:991, 2011.
- [83] C. C. Huang, B. D. Pelatt, and J. F. Conley Jr. *Nanotechnology*, 21:195307, 2010.
- [84] G. Shen, J. H. Cho, S. I. Jung, and C. J. Lee. *Chem. Phys. Lett.*, 401:529, 2005.
- [85] S. Muthukumar, C. R. Gorla, N. W. Emanetoglu, S. Liang, and Y. Lu. *Cryst. Growth*, 225:197, 2001.

- [86] H. Yuan and Y. Zhang. *J. Cryst. Growth*, 263:119, 2004.
- [87] C. J. Barrelet, Y. Wu, D. C. Bell, and C. M. Lieber. *J. Am. Chem. Soc.*, 125:11498, 2003.
- [88] B. Yang, A. Kumar, H. Zhang, P. Feng, R. S. Katiyar, and Z. Wang. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 42:045415, 2009.
- [89] M. Yang, H. C. Kim, and S. H. Hong. *Thin Solid Films*, 573:79, 2014.
- [90] Y. W. Heo, V. Varadarajan, M. Kaufman, K. Kim, D. P. Norton, F. Ren, and P. H. Fleming. *Appl. Phys. Lett.*, 81:3046, 2002.
- [91] P. K. Samanta and A. K. Bandyopadhyay. *Appl. Nanosci.*, 2:111, 2012.
- [92] H. V. D. Rul, D. Mondelaers, M. K. V. Bael, and J. Mullens. *J. Sol-Gel. Sci. Techn.*, 39:41, 2006.
- [93] B. Liu and H. C. Zeng. *J. Am. Chem. Soc.*, 125:4430, 2003.
- [94] A. Dev, S. Kar, S. Chakrabarti, and S Chaudhuri. *Nanotechnology*, 17:1533, 2006.
- [95] J. Lee, A. J. Easteal, U. Pal, and D. Bhattacharyya. *Current Appl. Phys.*, 9:792, 2009.
- [96] E. Karber, T. Raadik, T. Dedova, J. Krustok, A. Mere, V. Mikli, and M. Krunks. *Nanoscale Res. Lett.*, 6:359, 2011.
- [97] C. H. Ku and J. J. Wu. *Nanotechnology*, 18:505706, 2007.
- [98] N. Y. Rajeswari and A. C. Bose. *J. Solid State Chem.*, 184:12, 2011.
- [99] H. Li, S. Jiao, S. Bai, H. Li, S. Gao, J. Wang, Q. Yu, F. Guo, and L. Zhao. *Phys. Status Solidi A*, 211:595, 2014.

- [100] C. Y. Kuo, R. M. Ko, Y. C. Tu, Y. R. Lin, T. H. Lin, and S. J. Wang. *Cryst. Growth Des.*, 12:3849, 2012.
- [101] J. Zhang, D. Gao, G. Yang, Z. Zhu, J. Zhang, and Z. Shi. *Int. J. Mater. Mech. Eng.*, 1:38, 2012.
- [102] H. Zhang, D. Yang, S. Li, X. Ma, Y. Ji, J. Xu, and D. Que. *Mater. Lett.*, 59:1696, 2005.
- [103] G. Amin, M. H. Asif, A. Zainelabdin, S. Zaman, O. Nur, and M. Willander. *J. Nanomaterials*, 2011:1, 2011.
- [104] Z. W. Ai, Y. Wu, H. Wu, T. Wang, C. Chen, Y. Xu, and C. Liu. *Nanoscale Res. Lett.*, 8:105, 2013.
- [105] H. Hu, X. Huang, C. Deng, X. Chen, and Y. Qian. *Mater. Chem. Phys.*, 106:58, 2007.
- [106] W. T. Shi, G. Guo, and X. Lan. *Trans. Nonferrous Met. Soc. China*, 20:1049, 2010.
- [107] H. Zhang, D. Yang, X. Ma, Y. Ji, J. Xu, and D. Que. *Nanotechnology*, 15:622, 2004.
- [108] R. Zhang, X. Yang, D. Zhang, J. Qin, C. Lu, H. Ding, X. Yan, H. Tang, M. Wang, and Q. Zhang. *Cryst. Res. Technol.*, 46:1189, 2011.
- [109] H. Zhao, X. Su, F. Xiao, J. Wang, and J. Jian. *Mater. Sci. Eng. B*, 176:611, 2011.
- [110] K. S. Kim, H. Jeong, M. S. Jeong, and G. Y. Jung. *Adv. Funct. Mater.*, 20:3055, 2010.
- [111] S. Baruah and J. Dutta. *J. Sol-Gel Sci. Technol.*, 50:456, 2009.

- [112] W. Y. Wu, W. Y. Kung, and J. M. Ting. *J. Am. Ceram. Soc.*, 94:699, 2011.
- [113] J. Y. Lao, J. Y. Huang, D. Z. Wang, and Z. F. Ren. *Nano Letters*, 3:235, 2003.
- [114] A. Eftekhari, F. Molaei, and H. Arami. *Mater. Sci. Eng. A*, 437:446, 2006.
- [115] Y. Tong, Y. Liu, L. Dong, D. Zhao, J. Zhang, Y. Lu, D. Shen, and X. Fan. *J. Phys. Chem. B*, 110:20263, 2006.
- [116] X. Wang, Q. Zhang, Q. Wan, G. Dai, C. Zhou, and B. Zou. *J. Phys. Chem. C*, 115:2769, 2011.
- [117] H. Wang, J. Xie, K. Yan, and M. Duan. *J. Mater. Sci. Technol.*, 27(2):153, 2011.
- [118] L. Liu and W. A. Bassett. *Elements, Oxides, and Silicates*. Oxford University press, New York, 1986.
- [119] J. M. Recio, M. A. Blanco, V. Luana, R. Pandey, L. Gerward, and J. S. Olsen. *Phys. Rev. B*, 58:8949, 1998.
- [120] S. Desgreniers. *Phys. Rev. B*, 58:14102, 1998.
- [121] T. Dietl, H. Ohno, F. Matsukura, J. Cibert, and D. Ferrand. *Science*, 287:1019, 2000.
- [122] T. L. Tan, C. W. Lai, and S. B.A. Hamid. *J. Nanomater.*, 2013:1, 2013.
- [123] V. A. L. Roy, A. B. Djuricic, H. Liu, X. X. Zhang, Y. H. Leung, M. H. Xie, J. Gao, H. F. Lui, and C. Surya. *Appl. Phys. Lett.*, 84:756, 2004.

- [124] F. C. Romeiro, J. Z. Marinho, A. C. A. Silva, N. F. Cano, N. O. Dantas, and R. C. Lima. *J. Phys. Chem. C*, 117:26222, 2013.
- [125] K. Omri, J. E. Ghouli, O. M. Lemine, M. Bououdina, B. Zhang, and L. E. Mir. *Superlattice. Microst.*, 60:139, 2013.
- [126] Y. Q. Chang, P. W. Wang, R. H. Tang, Q. L. Sun, and Y. Long. *J. Mater. Sci. Technol.*, 27:513, 2011.
- [127] V. Gandhi, R. Ganesan, H. H. A. Syedahamed, and M. Thaiyan. *J. Phys. Chem. C*, 118:9715, 2014.
- [128] M. A. M. Khan, M. W. Khan, M. Alhoshan, M. S. AlSalhi, and A. S. Aldwayyan. *Appl Phys A*, 100:45, 2010.
- [129] S. Kuriakose, B. Satpati, and S. Mohapatra. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 16:12741, 2014.
- [130] Y. Z. Peng, T. Liew, W. D. Song, C. W. An, K. L. Teo, and T. C. Chong. *J. Supercond. Nov. Magn.*, 18:97, 2005.
- [131] S. Zhao, C. Yao, Q. Lu, F. Song, J. Wan, and G. Wang. *Trans. Nonferrous Met. Soc. China*, 19:1450, 2009.
- [132] C. J. Cong, J. H. Hong, Q. Y. Liu, L. Liao, and K. L. Zhang. *Solid State Commun.*, 138:511, 2006.
- [133] S. Kant and A. Kumar. *Adv. Mat. Lett.*, 3(4):350, 2012.
- [134] G. J. Huang, J. B. Wang, X. L. Zhong, G. C. Zhou, and H. L. Yan. *J. Mater. Sci.*, 42:6464, 2007.
- [135] M. Silambarasan, S. Saravanan, N. Ohtani, and T. Soga. *Jpn. J. Appl. Phys.*, 53:5S1, 2014.

- [136] G. Srinet, R. Kumar, and V. Sajal. *J. Appl. Phys.*, 114:033912, 2013.
- [137] M. Rajneesh, K. Krishnamoorthy, and S. J. Kim. *Solid State Commun.*, 152:375, 2012.
- [138] A. Arun, M. K. Jayaraj, K. Mukesh, and C. Ramesh. *J. Mater. Sci: Mater. Electron.*, 24:106, 2013.
- [139] M. Babikier, D. Wang, J. Wang, Q. Li, J. Sun, Y. Yan, Q. Yu, and S. Jiao. *Nanoscale Res. Lett.*, 9:199, 2014.
- [140] M. Mukhtar, L. Munisa, and R. Saleh. *Mater. Sci. Appl.*, 3:543, 2012.
- [141] L. Chow, O. Lupan, G. Chai, H. Khallaf, L. K. Ono, B. R. Cuenya, I. M. Tiginyanu, V. V. Ursaki, V. Sontea, and A. Schulte. *Sensor. Actuat. A-Phys.*, 189:399, 2013.
- [142] Y. M. Hao, S. Y. Lou, S. M. Zhou, R. J. Yuan, G. Zhu, and N. Li. *Nanoscale Res. Lett.*, 7:100, 2012.
- [143] J. Cui and U. Gibson. *Phys. Rev. B*, 74:045416, 2006.
- [144] C. Cheng, G. Xu, H. Zhang, and Y. Luo. *Mater. Lett.*, 62:1617, 2008.
- [145] T. Li, H. Fan, J. Yi, T. S. Herng, Y. Ma, X. Huang, J. Xue, and J. Ding. *J. Mater. Chem.*, 20:5756, 2010.
- [146] J. J. Feng, Q. C. Liao, A. J. Wang, and J. R. Chen. *Cryst. Eng. Comm.*, 13:4202, 2011.
- [147] C. Jiang, W. Zhang, G. Zou, W. Yu, and Y. Qian. *J. Phys. Chem. B*, 109:1361, 2005.

- [148] R. Yi, N. Zhang, H. Zhou, R. Shi, G. Qiu, and X. Liu. *Mater. Sci. Eng. B*, 153:25, 2008.
- [149] L. Yanmei, W. Tao, S. Xia, F. Qingqing, L. Qingrong, S. Xueping, and S. Zaoqi. *Appl. Surf. Sci.*, 257:6540, 2011.
- [150] O. Lupan, T. Pauporte, B. Viana, V. V. Ursaki, I. M. Tiginyanu, V. Son-tea, and L. Chow. *J. Nanoelectron. Optoelectron.*, 7:712, 2012.
- [151] G. P. Hernandez, A. E. Morales, U. Pal, and E. C. Anota. *Mater. Chem. Phys.*, 135:810, 2012.
- [152] D. Polsongkram, P. Chamninok, S. Pukird, L. Chow, O. Lupan, G. Chai, H. Khallaf, S. Park, and A. Schulte. *Physica B*, 403:3713, 2008.
- [153] K. Byrappa and T. Adschiri. *Prog. Cryst. Growth Ch.*, 53:117, 2007.
- [154] K. Byrappa and M. Yoshimura. *Handbook of Hydrothermal Technology*. Noyes Publications, USA, 2001.
- [155] W. S. Cho, M. Yashima, M. Kakihana, A. Kudo, T. Sakata, and M. Yoshimura. *Appl. Phys. Lett.*, 66:1027, 1995.
- [156] R. Jenkins. *X-ray Techniques: Overview*. John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
- [157] M. J. Buerger. *X-ray Crystallography*. John Wiley & Sons, New York, 1962.
- [158] B. D. Cullity and S. R. Stock. *Elements of X-ray diffraction*. Prentice Hall, New Jersey, 2001.
- [159] D. Henry. *X-ray reflection in accordance with Bragg's Law Author Profiles*. Louisiana State University, USA, 2010.

- [160] O. D. Jayakumar, H. G. Salunke, R. M. Kadam, M. Mahapatra, G. Yaswant, and S. K. Kulshreshtha. *Nanotechnology*, 17:1278, 2006.
- [161] JEOL. *Scanning Electron Microscope A To Z*. JEOL Ltd., Japan, 2001.
- [162] M. Dunlap and J. E. Adaskaveg. *Introduction to the Scanning Electron Microscope*. U. C. Davis, USA, 1997.
- [163] Hitachi S-4800 scanning electron microscope. *Product catalogue*. Hitachi High-Technologies, Japan.
- [164] D. B. Williams and C. B. Carter. *Transmission electron microscopy*. Springer, Berlin, 2009.
- [165] JEOL JEM-2100 transmission electron microscope. *Product catalogue*. JEOL, USA.
- [166] B. K. Agarwal. *X-ray Spectroscopy*. Springer-verlag, Berlin, 1991.
- [167] S. J. B. Reed. *Electron Microprobe Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1993.
- [168] L. Reimer. *Scanning Electron Microscopy*. Springer-Verlag, Berlin, 1985.
- [169] J. C. Russ. *Fundamentals of Energy Dispersive X-ray Analysis*. Butterworths, London, 1984.
- [170] M. Joshi, A. Bhattacharyya, and S. W. Ali. *Indian J. Fibre & Textile Res*, 33:304, 2008.
- [171] C. C. Chusuei and D. W. Goodman. *X-ray Photoelectron Spectroscopy*. Academic press, New York, 2002.

- [172] Kratos AXIS Ultra spectrometer. *Product catalogue*. Kratos AXIS Ultra, UK.
- [173] J. Torrent and V. Barron. *Diffuse Reflectance Spectroscopy*. University of Cordoba, Spain, 2008.
- [174] P. Kubelka. *J. Opt. Soc. Am.*, 38:448, 1948.
- [175] G. Burns. *Solid State Physics*. Academic Press, London, 1985.
- [176] P. C. Painter and R. W. Snyder. *Materials Science and Engineering Department*. The Pennsylvania State University, USA, 1979.
- [177] B. H. Stuart. *Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications*. Wiley, Germany, 2004.
- [178] Thermo Nicolet. *Introduction to Fourier Transform Infrared Spectrometry*. A Thermo Electron business, USA, 2001.
- [179] Princeton Instruments. *Raman Spectroscopy Basics*. Princeton Instruments, USA, 2001.
- [180] C. V. Raman and K. S. Krishnan. *Nature*, 121:501, 1928.
- [181] G. S. Bumbrah and R. M. Sharma. *Egypt. J. Forensic. Sci.*, page doi:10.1016/j.ejfs.2015.06.001, 2015.
- [182] E. Smith and G. Dent. *Modern Raman spectroscopy: a practical approach*. Wiley, England, 2005.
- [183] Thermo Electron Scientific Instruments. *Introduction to Raman Spectroscopy*. Thermo Electron Corporation, USA, 2003.

- [184] Horiba Jobin Yvon Lab Ram HR spectrometer. *Product catalogue*. Horiba Jobin Yvon, USA.
- [185] T. H. Gfroerer. *Photoluminescence in Analysis of Surfaces and Interfaces*. Wiley, Chichester, 2006.
- [186] A. R. Barron. *Physical Methods in Chemistry and Nano Science*. Creative Commons Attribution, USA, 2014.
- [187] D. Heiman. *Photoluminescence Spectroscopy*. Northeastern University, USA, 2004.
- [188] C. Pamela and Las Vegas Burnley, University of Nevada. *The Diamond Anvil Cell (DAC)*. University of Nevada, Las Vegas, 2013.
- [189] A. Jayaraman. *J. de Physique*, 45:355, 1984.
- [190] S. Yang and D. Zhaohui. *Novel Pressure - Induced Structural Transformations of Inorganic Nanowires*. University of Western Ontario, Canada, 2011.
- [191] R. L. Fagaly. *SQUID Instruments and Applications*. Tristan Technologies, USA, 2005.
- [192] M. Mc Elfresh. *Fundamentals of magnetism and magnetic measurements featuring Quantum Design's magnetic property measurement system*. Purdue University, USA, 1994.
- [193] H. C. Yang, J. H. Chen, S. Y. Wang, C. H. Chen, J. T. Jeng, J. C. Chen, C. H. Wu, S. H. Liao, and H. E. Horng. *Tamkang J. Sci. Eng.*, 6:9, 2003.
- [194] W. Burgei, M. J. Pechan, and H. Jaeger. *Am. J. Phys.*, 71:825, 2003.
- [195] S. Foner. *Rev. Sci. Instruments*, 30:548, 1959.

- [196] D. C. Reynolds, D. C. Look, B. Jogai, J. E. Hoelscher, M. T. Harris R. E. Sherriff, and M. J. Callahan. *J. Appl. Phys.*, 88:2152, 2000.
- [197] L. Y. Yang, S. Y. Dong, J. H. Sun, J. L. Feng, Q. H. Wu, and S. P. Sun. *J. Hazardous Mater.*, 179:438, 2010.
- [198] W. Yang, Q. Li, S. Gao, and J. K. Shang. *Nanoscale Res. Lett.*, 6:491, 2011.
- [199] U. Pal and P. Santiago. *J. Phys. Chem. B*, 109:15317, 2005.
- [200] Y. Tak and K. Yong. *J. Phys. Chem. B*, 109:19263, 2005.
- [201] P. Yang, H. Yan, S. Mao, R. Russo, J. Johnson, R. Saykally, N. Morris, J. Pham, H. Rongrui, and H. J. Choi. *Adv. Funct. Mater.*, 12:323, 2002.
- [202] J. Lao, J. Huang, D. Wang, and Z. Ren. *Nano Lett.*, 3:235, 2003.
- [203] R. A. Mc Bride, J. M. Kelly, and D. E. Mc Cormack. *J. Mater. Chem*, 13:1196, 2003.
- [204] L. Vayssieres, K. Keis, A. Hagfeldt, and S. E. Lindquist. *Chem. Mater.*, 13:4395, 2001.
- [205] Y. H. Ko, M. S. Kim, and J. S. Yu. *Nanoscale Res. Lett.*, 7:13, 2012.
- [206] Y. Zhang, W. Zhang, and H. Zheng. *Scr. Mater.*, 57:313, 2007.
- [207] G. Haiyong, Y. Fawang, L. Jinmin, Z. Yiping, and W. Junxi. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 40:3654, 2007.
- [208] Y. Chen, C. L. Zhu, and G. Xiao. *Nanotechnology*, 17:4537, 2006.
- [209] C. Y. Jiang, X. W. Sun, G. Q. Lo, and D. L. Kwong. *Appl. Phys. Lett.*, 90:263501, 2007.

- [210] Y. J. Kim, J. Yoo, B. H. Kwon, Y. J. Hong, C. H. Lee, and G. C. Yi. *Nanotechnology*, 19:315202, 2008.
- [211] W. Yuxin, L. Xinyong, W. Ning, Q. Xie, and C. Yongying. *Separation Purification Technol.*, 62:727, 2008.
- [212] G. Jiechao, T. Bo, Z. Linhai, and S. Zhiqiang. *Nanotechnology*, 17:1316, 2006.
- [213] D. Chu, M. Yoshitake, O. Tatsuki, and K. Kazumi. *J. Am. Ceram. Soc.*, 93:887, 2010.
- [214] J. R. Carvajal. *Fullprof: a program for Rietveld Refinement and Profile Matching analysis of Complex Powder Diffraction Patterns ILL*. Laboratoire Leon Brillouin (CEA-CNRS), France, 2001.
- [215] M. A. Moram and M. E. Vickers. *Rep. Prog. Phys.*, 72:036502, 2009.
- [216] D. Sameer, P. Swanand, V. N. T. K. Satyanarayana, and S. Sudipta. *Appl. Phys. Lett.*, 87:133113, 2005.
- [217] M. Mehrabian, R. Azimirad, K. Mirabbaszadeh, H. Afarideh, and M. Davoudian. *Physica E*, 43:1141, 2011.
- [218] R. Cusco, E. Llado, J. Ibanez, L. Artus, J. Jimenez, B. Wang, and M. J. Callahan. *Phys. Rev. B*, 75:165202, 2007.
- [219] U. Pal, S. J. Garcia, P. Santiago, X. Gang, K. B. Ucer, and R. T. Williams. *Opt. Mater.*, 29:65, 2006.
- [220] L. W. Yang, X. L. Wu, G. S. Huang, T. Qiu, and Y. M. Yang. *J. Appl. Phys.*, 97:014308, 2005.

- [221] M. Rajalakshmi, A. K. Arora, B. S. Bendre, and S. Mahamuni. *J. Appl. Phys.*, 87:2445, 2000.
- [222] W. Rizwan, S. G. Ansari, Y. S. Kim, H. K. Seo, G. S. Kim, G. Khang, and S. S. Shin. *Mater. Res. Bull.*, 42:1640, 2007.
- [223] F. Decremps, J. P. Porres, A. M. Saitta, J. C. Chervin, and A. Polian. *Phys. Rev. B*, 65:092101, 2002.
- [224] Z. Q. Chen, A. Kawasuso, Y. Xu, H. Naramoto, X. L. Yuan, T. Sekiguchi, R. Suzuki, and T. Ohdaira. *Phys. Rev. B*, 71:115213, 2005.
- [225] M. Haase, H. Weller, and A. Henglein. *J. Phy. Chem.*, 92:482, 1998.
- [226] P. Kubelka and F. Munk. *Z. Tech. Phys.*, 12:593, 1931.
- [227] T. Omata, N. Ueda, K. Ueda, and H. Kawazoe. *Appl. Phys. Lett.*, 64:1077, 1994.
- [228] K. S. Kim, H. Jeong, M. S. Jeong, and G. Y. Jung. *Adv. Funct. Mater.*, 20:3055, 2010.
- [229] S. Gao, H. Zhang, X. Wang, R. Deng, D. Sun, and G. Zheng. *J. Phys. Chem. B*, 110:15847, 2006.
- [230] D. M. Bagnall, Y. F. Chen, Z. Zhu, T. Yao, M. Y. Shen, and T. Goto. *Appl. Phys. Lett.*, 73:1038, 1998.
- [231] R. Wu, Y. Yang, S. Cong, Z. Wu, C. Xie, H. Usui, K. Kawaguchi, and N. Koshizaki. *Chem. Phys. Lett.*, 406:457, 2005.
- [232] F. Decremps, J. P. Porres, F. Datchi, J. P. Itie, A. Polian, F. Baudelet, and J. Z. Jiang. *Appl. Phys. Lett.*, 81:4820, 2002.

- [233] B. Wen and R. Melnik. *Chem. Phys. Lett.*, 466:84, 2008.
- [234] A. Mang, K. Reimann, and St. Rubenacke. *Solid State Commun.*, 94:251, 1995.
- [235] A. Segura, J. A. Sans, F. J. Manjon, A. Munoz, and M. J. H. Cabrera. *Appl. Phys. Lett.*, 83:278, 2003.
- [236] F. Decremps, F. Datchi, M. A. Saitta, A. Polian, S. Pascarelli, A. D. Cicco, J. P. Itie, and F. Baudalet. *Phys. Rev. B*, 68:104101, 2003.
- [237] S. J. Chen, Y. C. Liu, C. L. Shao, C. S. Xu, Y. X. Liu, L. Wang, B. B. Liu, and G. T. Zou. *J. Appl. Phys.*, 98:106106, 2005.
- [238] S. J. Chen, Y. C. Liu, C. L. Shao, C. S. Xu, Y. X. Liu, C. Y. Liu, B. P. Zhang, L. Wang, B. B. Liu, and G. T. Zou. *Appl. Phys. Lett.*, 88:133127, 2006.
- [239] A. Duzynska, R. Hrubiak, V. Drozd, H. Teisseyre, W. Paszkowicz, A. Reszka, A. Kaminska, S. Saxena, J. D. Fidelus, J. Grabis, C. J. Monty, and A. Suchocki. *High Press. Res.*, 32:354, 2012.
- [240] W. Shan, W. Walukiewicz, J. W. Ager III, K. M. Yu, Y. Zhang, S. S. Mao, R. Kling, C. Kirchner, and A. Waag. *Appl. Phys. Lett.*, 86:153117, 2005.
- [241] Y. Xiaoqin, Y. Gu, X. Zhang, Y. Huang, J. Qi, Y. Zhang, T. Fujita, and M. Chen. *J. Phys. Chem. C*, 113:1164, 2009.
- [242] R. L. Toullec, J. P. Pinceaux, and P. Loubeyre. *High Press. Res.*, 1:77, 1988.

- [243] H. K. Mao, P. Bell, J. Shaner, and D. Steinberg. *J. Appl. Phys.*, 49:3276, 1978.
- [244] R. Vinod, P. Sajan, R. A. Sreekumar, M. T. Carmen, M. S. Vicente, and M. J. Bushiri. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 45:425103, 2012.
- [245] J. P. Porres, A. Segura, V. Panchal, A. Polian, F. Decremps, and P. Dumas. *Phys. Rev. B*, 84:125202, 2011.
- [246] F. J. Manjon, K. Syassen, and R. Lauck. *High Press. Res.*, 22:209, 2002.
- [247] J. Serrano, A. H. Romero, F. J. Manjon, R. Lauck, M. Cardona, and A. Rubio. *Phys. Rev. B*, 69:094306, 2004.
- [248] F. J. Manjon, B. Mari B, J. Serrano, and R. H. Romero. *J. Appl. Phys.*, 97:053516, 2005.
- [249] L. Bayarjargal, L. Wiehland, and B. Winkler. *High Press. Res.*, 33:642, 2013.
- [250] J. Z. Jiang, J. S. Oslen, L. Gerward, D. Frost, D. Rubie, and J. Peyronneau. *Europhys. Lett.*, 50:48, 2000.
- [251] J. Serrano, F. Widulle, A. H. Romero, A. Rubio, R. Lauck, and M. Cardona. *Phys. Status Solidi B*, 235:260, 2003.
- [252] M. Millot, R. T. Zaera, V. M. Sanjose, J. M. Broto, and J. Gonzalez. *Appl. Phys. Lett.*, 96:152103, 2010.
- [253] J. Gonzalez, J. Marquina, F. Rodriguez, and R. Valiente. *High Press. Res.*, 29:594, 2009.
- [254] S. Klotz, J. M. Besson, M. Braden, K. Karch, P. Pavone, D. Strauch, and W. G. Marshall. *Phys. Rev. Lett.*, 79:1313, 1997.

- [255] J. M. Baik and J. L. Lee. *Adv. Mater.*, 17:2745, 2005.
- [256] X. C. Liu, H. W. Zhang, T. Zhang, B. Y. Chen, Z. Z. Chen, L. X. Song, and E. W. Shi. *Chin. Phys. B*, 17:1371, 2008.
- [257] H. S. Kang, B. D. Ahn, J. H. Kim, G. H. Kim, S. H. Lim, H. W. Chang, and S. Y. Lee. *Appl. Phys. Lett.*, 88:202108, 2006.
- [258] R. Vinod, M. J. Bushiri, P. Sajan, R. A. Sreekumar, and V. M. Sanjose. *Phys. Status Solidi A*, 211:1155, 2014.
- [259] J. Xu, Y. Chen, and J. Shen. *J. Nanosci. Nanotechnol.*, 6:248, 2006.
- [260] Y. Zhang, J. Xu, Q. Xiang, H. Li, Q. Pan, and P. Xu. *J. Phys. Chem. C*, 113:3430, 2009.
- [261] L. Vayssieres. *Adv. Mater.*, 15:464, 2003.
- [262] S. V. Bhat and F. L. Deepak. *J. Solid State Commun.*, 135:345, 2005.
- [263] R. Viswanatha, S. Sapra, S. S. Gupta, B. Satpati, P. V. Satyam, B. N. Dev, and D. D. Sarma. *J. Phys. Chem. B*, 108:6303, 2004.
- [264] X. Ma and Z. Wang. *Microelectron. Eng.*, 88:3168, 2011.
- [265] S. Senthilkumaar, K. Rajendran, S. Banerjee, T. K. Chini, and V. Sengodan. *J. Mater.Sci. Semicond. Process*, 11:6, 2008.
- [266] X. B. He, T. Z. Yang, J. M. Cai, C. D. Zhang, H. M. Guo, D. X. Shi, C. D. Shen, and H. J. Gao. *Chin. Phys. B*, 17:3444, 2008.
- [267] Z. K. Hong, L. Zheng, L. Ji, H. L. Jun, W. D. Wei, C. C. Ying, and S. L. Feng. *Chin. Phys. B*, 19:026101, 2010.

- [268] K. Ueda, H. Tabata, and T. Kawai. *Appl. Phys. Lett.*, 79:988, 2001.
- [269] M. Yuji, M. Makoto, S. Tomoji, H. Tetsuya, F. Tomoteru, K. Masashi, A. Parhat, C. Toyohiri, Y. S. Shin, and K. Hideomi. *Science*, 291:854, 2001.
- [270] S. B. Ogale, R. J. Choudhary, J. P. Buban, S. E. Lofland, S. R. Shinde, S. N. Kale, V. N. Kulkarni, J. Higgins, C. Lanci, J. R. Simpson, N. D. Browning, S. S. Das, H. D. Drew, R. L. Greene, and T. Venkatesan. *Phys. Rev. Lett.*, 91:077205, 2003.
- [271] N. H. Hong, J. Sakai, N. Poirot, and A. Ruyter. *Appl. Phys. Lett.*, 86:242505, 2005.
- [272] W. Prellier, A. Foucheta, and B. Mercey. *J. Phys.: Condens. Matter.*, 15:R1583, 2003.
- [273] J. M. D. Coey, M. Venkatesan, and C. B. Fitzgerald. *Nature Mater.*, 4:173, 2005.
- [274] X. Y. Zhang, J. Y. Dai, and H. C. Ong. *Open J. Phys. Chem.*, 1:6, 2011.
- [275] P. Sharma, A. Gupta, K. V. Rao, F. J. Owens, R. Sharma, R. Ahuja, G. J. M. Osorio, B. Johansson, and G. A. Gehring. *Nature Mater.*, 2:673, 2003.
- [276] K. Sato and Y. H. Katayama. *Physica E*, 10:251, 2001.
- [277] Y. Q. Chang, D. B. Wang, X. H. Luo, X. Y. Xu, X. H. Chen, L. Li, C. P. Chen, R. M. Wang, J. Xu, and D. P. Yu. *Appl. Phys. Lett.*, 83:4020, 2003.

- [278] L. Jin, F. Huiqing, C. Xiaopeng, and C. Zhiyi. *Colloids Surfaces A*, 349:202, 2009.
- [279] J. X. Wang, X. W. Sun, Y. Yang, H. Huang, Y. C. Lee, O. K. Tan, and L. Vayssieres. *Nanotechnology*, 17:4995, 2006.
- [280] L. E. Greene, M. Law, J. Goldberger, F. Kim, J. C. Johnson, Y. F. Zhang, R. J. Saykally, and P. D. Yang. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 42:3031, 2003.
- [281] Y. Guo, X. Cao, X. Lan, C. Zhao, X. Xue, and Y. Song. *J. Phys. Chem. C*, 112:8832, 2008.
- [282] D. A. Schwartz and D. R. Gamelin. *Adv. Mater.*, 16:2115, 2004.
- [283] N. H. Hong, N. Poirot, and J. Sakai. *Appl. Phys. Lett.*, 89:042503, 2006.
- [284] Y. B. Lin, J. P. Xu, W. Q. Zou, L. Y. Lv, Z. H. Lu, F. M. Zhang, Y. W. Du, Z. G. Huang, and J. G. Zheng. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 40:3674, 2007.
- [285] J. H. Li, D. Z. Shen, J. Y. Zhang, D. X. Zhao, B. S. Li, Y. M. Lu, Y. C. Liu, and X. W. Fan. *J. Magn. Magn. Mater.*, 302:118, 2006.
- [286] M. H. F. Sluiter, Y. Kawazoe, P. Sharma, A. Inoue, A. R. Raju, C. Rout, and U. V. Waghmare. *Phys. Rev. Lett.*, 94:187204, 2005.
- [287] B. Zhang, M. Li, J. Z. Wang, L. Q. Shi, and H. S. Cheng. *Mater. Sci. Appl.*, 4:307, 2013.
- [288] D. Igor, G. George, A. Denis, P. Matej, J. Zvonko, and N. Markus. *J. Mater. Chem.*, 18:5208, 2008.
- [289] P. Singh, A. Kaushal, and D. Kaur. *J. Alloys Compd.*, 471:11, 2009.

- [290] X. Xie, P. Shang, Z. Liu, Y. Lv, Y. Li, and W. Shen. *J. Phys. Chem. C*, 114:2116, 2010.
- [291] A. Srivastava, N. Kumar, and S. Khare. *Opt. Electron. Rev.*, 22:68, 2014.
- [292] B. N. Mavrin, L. N. Demyanets, and R. M. Zakalukin. *Phys. Lett. A*, 374:4054, 2010.
- [293] J. H. Zheng, Q. Jiang, and J. S. Lian. *Appl. Surf. Sci.*, 257:5083, 2011.
- [294] F. Decremps, J. P. Porres, A. M. Saitta, J. C. Chervin, and A. Polian. *Phys. Rev. B*, 65:092101, 2002.
- [295] J. B. Wang, G. J. Huang, Z. L. Zhong, L. Z. Sun, and Y. C. Zhou. *Appl. Phys. Lett.*, 88:252502, 2006.
- [296] J. B. Wang, H. M. Zhong, Z. F. Li, and W. Lu. *J. Appl. Phys.*, 97:086105, 2005.
- [297] T. L. Phan, S. C. Yu, R. Vincent, H. M. Bui, T. D. Thanh, V. D. Lam, and Y.P. Lee. *J. Appl. Phys.*, 108:044910, 2010.
- [298] T. L. Phan, Y. K. Sun, R. Vincent, D. Cherns, N. X. Nghia, and S. C. Yu. *J. Korean Phys. Soc.*, 52:1633, 2008.
- [299] K. Sakai, T. Kakeno, T. Ikari, S. Shirakata, T. Sakemi, K. Awai, and T. Yamamoto. *J. Appl. Phys.*, 99:043508, 2006.
- [300] M. Diaconu, H. Schmidt, H. Hochmuth, M. Lorenz, G. Benndorf, D. Spemann, J. Lenzner, A. Setzer, K. W. Nielsen, P. Esquinazi, and M. Grundmann. *Thin Solid Films*, 486:117, 2005.
- [301] X. T. Zhang, Y. C. Liu, J. Y. Zhang, Y. M. Lu, D. Z. Shen, X. W. Fan, and X. G. Kong. *J. Cryst. Growth*, 254:80, 2003.

- [302] P. Rai, S. K. Tripathy, N. H. Park, K. O. Joong, I. H. Lee, and Y. T. Yu. *J. Mater. Sci. Mater. Electron.*, 20:967, 2009.
- [303] S. Chakraborty, C. S. Tiwary, A. K. Kole, P. Kumbhakar, and K. Chattopadhyay. *Mater. Lett.*, 91:379, 2003.
- [304] J. Li, H. Fan, X. Chen, and Z. Cao. *Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects*, 349:202, 2009.
- [305] B. B. Straumal, S. G. Protasova, A. A. Mazilkin, G. Schutz, E. Goering and B. Baretzky, and P. B. Straumal. *JETP Lett.*, 97:415, 2013.
- [306] B. B. Straumal, A. A. Mazilkin, S. G. Protasova, P. B. Straumal, A. A. Myatiev, G. Schutz, E. J. Goering, T. Tietze, and B. Baretzky. *Philos. Mag.*, 93:1371, 2013.
- [307] S. W. Jung, S. J. An, J. C. Yi, C. U. Jung, S. I. Lee, and S. Cho. *Appl. Phys. Lett.*, 80:4561, 2002.
- [308] J. Young-II, F. C. Chou, and Y. M. Chiang. *Appl. Phys. Lett.*, 74:2504, 1999.
- [309] D. N. H. Nam, R. Mathieu, P. Nordblad, N. V. Khiem, and N. X. Phuc. *Phys. Rev. B*, 62:8989, 2000.
- [310] R. Mathieu, P. Jonsson, D. N. H. Nam, and P. Nordblad. *Phys. Rev. B*, 63:092401, 2001.
- [311] T. Nidhi, M. Y. Seikh, and V. Y. Jatinder. *Phys. Chem. Chem. Phys*, 12:12208, 2010.
- [312] C. Tien, C. H. Feng, C. S. Wur, and J. J. Lu. *Phys. Rev. B*, 61:1251, 2000.

- [313] S. L. Young, H. Z. Chen, L. Hong, J. B. Shi, and Y. C. Chen. *Jpn. J. Appl. Phys.*, 40:4878, 2001.
- [314] M. Svedberg, S. Majumdar, H. Huhtinen, P. Paturi, and S. Granroth. *J. Phys.: Condens. Matter*, 23:386005, 2011.
- [315] M. Gruyters. *Phys. Rev. Lett.*, 95:077204, 2005.
- [316] F. Lefloch, J. Hammann, M. Ocio, and E. Vincent. *Physica B*, 203:63, 1994.
- [317] J. R. L. De Almeida and D. J. Thouless. *J. Phys. A*, 11:983, 1978.
- [318] R. Vinod, P. Sajan, R. A Sreekumar, , M. S. Vicente, and M. J. Bushiri. *Mater. Sci. and Eng. B*, 191:1, 2015.
- [319] A. W. Jefferson, F. D. Nadia, and S. Rosari. *Adv. Mater. Phys. Chem.*, 3:48, 2013.
- [320] X. Y. Xu and C. B. Cao. *J. Magn. Magn. Mater.*, 321:2216, 2009.
- [321] X. Jianping, S. Shaobo, L. Lan, Z. Xiaosong, W. Youwei, S. Qingliang, L. Shubin, and W. Hao. *J. Electron. Mater.*, 42:3438, 2013.
- [322] T. T. Lion, N. N. Long, and L. Hong. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 42:065412, 2009.
- [323] T. Al-Harbi. *J. Alloy. Compd.*, 509:387, 2011.
- [324] S. J. Pearton, D. P. Norton, M. P. Ivill, A. F. Hebard, J. M. Zavada, W. M. Chen, and I. A. Buyanova. *IEEE Transaction on Electron Devices*, 54:1040, 2007.
- [325] M. Mustaqima and C. Liu. *Turk. J. Phys.*, 38:429, 2014.

- [326] L. Jiang, G. Li, Q. Ji, and H. Peng. *Mater. Lett.*, 61:1964, 2007.
- [327] J. H. Jeon, S. Y. Jeong, C. R. Cho, S. A. Lee, W. J. Lee, H. S Ahn, and H. S Kim. *J. Korean Phys. Soc.*, 54:858, 2009.
- [328] J. Mass, P. Bhattacharya, and R. S. Katiyar. *Mater. Sci. Eng. B*, 103:9, 2003.
- [329] Y. Lin and Q. F. Jiang. *Appl. Surf. Sci.*, 257:8728, 2011.
- [330] J. H. Zheng, Q. Jiang, and J. S. Lian. *Appl. Surf. Sci.*, 257:5083, 2011.
- [331] B. N. Mavrin, L. N. Demyanets, and R. M. Zakalukin. *Phys. Lett. A*, 374:4054, 2010.
- [332] M. Scepanovic, M. Grujic-Brojcin, K. Vojisavljevic, S. Bernik, and T. Sreckovic. *J. Raman Spectrosc.*, 41:914, 2010.
- [333] W. Yang, Q. Li, S. Gao, and J.K. Shang. *Nanoscale Res. Lett.*, 6:491, 2011.
- [334] A. E. Morales, E. S. Mora, and U. Pal. *Revista Mexicana De Fisica S*, 53:18, 2007.
- [335] J. Xu, S. Shi, L. Li, X. Zhang, Y. Wang, Q. Shi, S. Li, and H. Wang. *J. Electron. Mater.*, 42:3438, 2013.
- [336] R. Vidya, P. Ravindran, H. Fjellvag, B. G. Svensson, E. Monakhov, M. Ganchenkova, and R. M. Nieminen. *Phys. Rev. B*, 83:045206, 2011.
- [337] J. Antony, S. Pendyala, A. Sharma, X. B. Chen, J. Morrison, L. Bergman, and Y. Qianga. *J. Appl. Phys.*, 97:10D307, 2005.
- [338] B. J. Jin, S. Im, and S. Y. Lee. *Thin Solid Films*, 366:107, 2000.

- [339] P. Li, S. Wang, J. Li, and Y. Wei. *J. Lumin.*, 132:220, 2012.
- [340] N. S. Sabri, A. K. Yahya, and M. K. Talari. *J. Lumin.*, 132:1735, 2012.
- [341] A. Mahroug, S. Boudjadar, S. Hamrit, and L. Guerbous. *J. Mater. Sci: Mater. Electron.*, 25:4967, 2014.
- [342] R. Bhargava, P. K. Sharma, R. K. Dutta, S. Kumar, A. C. Pandey, and N. Kumar. *Mater. Chem. Phys.*, 120:393, 2010.
- [343] B. Pal and P. K. Giri. *J. Appl. Phys.*, 108:084322, 2010.
- [344] S. J. Pearton, W. H. Heo, M. Ivill, D. P. Norton, and T. Steiner. *Semicond. Sci. Technol.*, 19:R59, 2004.
- [345] Q. Ma, J. T. Prater, C. Sudakar, R. A. Rosenberg, and J. Narayan. *J. Phys.: Condens. Matter*, 24:306002, 2012.